Microl	ns subs	trate.
--------	---------	--------

Patent Number:

EP0658779, A3, B1

Publication date:

1995-06-21

Inventor(s):

MIZUGUCHI YOSHIHIRO (JP); YAMASHITA TSUKASA (JP); AOYAMA SHIGERU

(JP); HAMADA HIROSHI (JP)

Applicant(s):

SHARP KK (JP); OMRON TATEISI ELECTRONICS CO (JP)

Requested

Patent:

☐ JP7225303

Application

Number:

EP19940309455 19941216

Priority Number

(s):

JP19930317145 19931216; JP19940306650 19941209

IPC Classification: G02B3/00

EC Classification: <u>B29D11/00C6</u>, <u>G02B3/00A</u>, <u>G02F1/1335L</u>

Equivalents:

DE69426971D, DE69426971T,
US5543942

Cited patent(s):

JP3230567; JP6165623; JP6175120; JP6232379

Abstract

The present invention discloses an opposed substrate (9) for use in a liquid crystal display element, for example. The opposed substrate is constructed by a transparent substrate (1), microlenses (2) formed on the substrate, a bonding layer (3), and cover glass (4). An alignment film and transparent electrodes are formed on the cover glass. The microlenses (2) and the bonding layer (3) are formed by selected resins which have thermal resistance to high temperatures not lower than 150 DEG C, permit heating treatment for forming the alignment film, and have a difference in refractive indexes between the resins, DELTA n >/= 0. 1, so as to enable the microlenses to have a numerical aperture not lower than 0. 1. It is thus possible to prevent the decomposition of resins and separation of the microlens in heat treatment

and to provide a high-quality, highly reliable liquid crystal display element.



Data supplied from the esp@cenet database - 12

R:870

P. 06

P. 0!

374475-1

į

2003/11/13 08:41:14

蛬 國專利公報 民 [19][12]

[1]] 公告期號: 374475

(41)中華民國88年(1988)11月11日

(51) 1 n t . C 1 = : 00103-36

得:新通报基据,使用超最越接基据之诸岛副示元件及该品级联装置 (SA)&

(21)中将室址:85201004

(2)中時日期:中華民國東京年(1904)12月15日

(72)創 作

水口養弘 摄图法

出本 日本

传山及身 山下牧

日本 0 =

(7) 中 章 人: 歌詞觀摩魯羽靡公司

日本

(74)代 項 人:何全独 先生

1

[57]申滑導利範圍:

1.一個微速調基板,具有:

第1透明基板;

設在第I透明著板上成為陣列狀·並由 具150℃以上耐熱性的硬化性樹脂所形 成,而將入射光予以集光之集光精件; 設在上述無光備件上的第2選明基板:

其特徵保由其150℃以上耐熱性的硬化 性揭脂所形成之接著槽件,將上述氣光 標件和第2透明基板予以貼合者・

- 2.如申請專利範圍第1項之微速鏡基板。 共中接光槽件由具190℃以上耐熱性的 硬化性樹脂所形成・及 由具190℃以上耐熱性的硬化性樹脂所 形成之接著欄件・將上並彙光欄件和第 2 透明基板予以貼合署。
- 3.如申請專利範圍第1政第2項之微選鏡 基板・其中

上述集光柄件係為微逻鏡陣列或為雙凸 透鏡者。

4.如申禮專利範圍第1或第2項之徵透觀 基板・其中

2

上述集光構件和接著模件係由紫外趨感 光性樹脂所形成者·

5. 5.一種液晶顯示元件,其保由:

(a)第1透明基板:(b)設在第1透明基板 上成為陣列狀,並由具150℃以上耐點 性的硬化性樹脂所形成,而將入射光子 以無光之集光精件:(c)設在上述集光精

- 10. 件上的第2透明基板:及(d)其特徵保由 具150℃以上耐熱性之硬化樹脂所形成 之接著構件・時上述集光構件和第2號 明基板予以貼合所構成之對向基板、並 在該對向基板上設有透明電極、配向
- 15. 膜、及黑底,並且具有主動矩阵基板, 並在

上述對向基板和上述主動矩隊基板之 間・設有液晶層者・

6.如甲磺專利範圍第5項之被品顯示元 件,其中集光榜件由具190℃以上耐熱 20.

P. 10

374475-2

)

)

2003/11/13 08:41:17

(2)

性的硬化性樹脂所形成:及由與190℃ 以上耐熱性之硬化樹脂所形成之按著模件,將上建築光模作和第2週明基板予以貼合。

3

7.一種液晶投影裝置,其保使用: 由(a)第1鑑明基板;(b)設在第1强明基板上成為降列狀、並由具150℃以上耐熱性的硬化性樹脂所形成,而將入射光予以類光之集光模件;(c)設在上述集光模件上的第2强明基板;及

(d)其特徵係由具150℃以上耐熱性之硬化性樹脂所形成之接著精件,將上述集光機件和第2透明基板予以貼合,所構成之對向基板,並在該對向基板上設有透明電極、配向膜、及黑底,並且具有主動矩阵基板,並在上述對向差板和上述主動矩阵基板之間設有被品層之液品單示元件者。

8.如申請專利範圍第7項之液晶投影接 置,其中華光輔件由具190℃以上耐熱 20. 性的硬化性樹脂所形成,而將入射光予 以集光;及由具190℃以上耐熱性之硬 化性樹脂所形成之接著精件,將上並集 光模件和第2透明基板予以貼合。

9.如申請專利範圍第7或第8項之被品投 影裝置,其中進一步具可將上述液品與 示元件的透過光加以蒸光,投影於構成 為該液品投影裝置上的部分之銀幕上 或投影於設在該被品投影裝置的外部銀 幕上之投影透鏡,該投影透鏡的開口數 係比上逃劫透鏡陣列或雙凸透鏡的開口 數為大之投影透鏡者。

10. 國式簡單說明:

第一圖本創作一實施例中,說明被 品顯示元件構造之斷面圖。

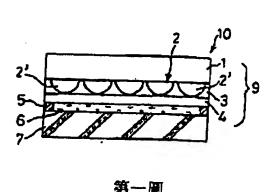
第二圖用 2P 法製造壓模之製造過程 說明圖·

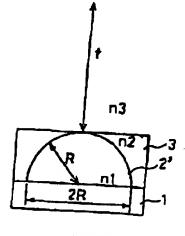
第三圖用配模製造撒透鏡陣列之製造過程說明圖。

第四個傻在上途被品牌示元件的做 遊鏡基板上之半球形(球面)做遊鏡重要部 位說明用斷面圖。

20. 第五圖使用上述液晶顯示裝置的液晶投影裝置之主要部位構成說明圖。

第六圈使用上述被基礎示裝置的液 品投影裝置之整體構成就明圖。





第四冊

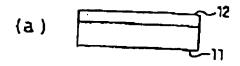
P. 11

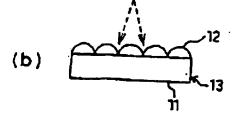
374475-3

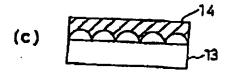
}

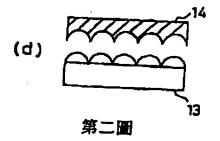
2003/11/13 08:41:18

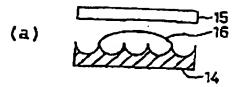
(3)

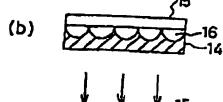


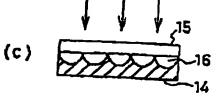


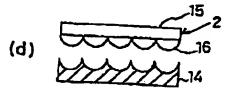












第三圖

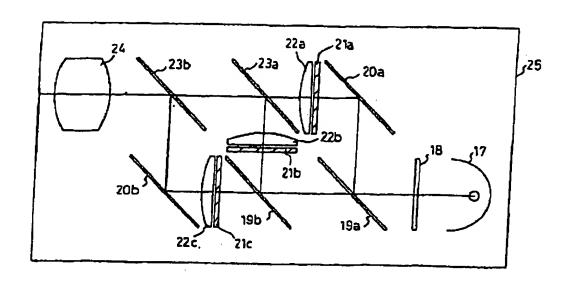
R: 870 P. 09

P. 12

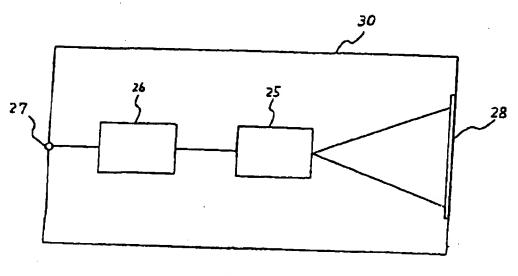
374475-4

2003/11/13 08:41:19

(4)



第五圖



第六圖